## LE100 Introduction à l'Electronique

## Le transistor

Farouk Vallette

# Un peu d'histoire

1904: Invention de la diode par FLEMMING

1907: Mise au point de la triode

**1948**: Le transistor bipolaire à jonctions (BARDEEN, BRATTAIN & SHOCKLEY)

BRATTAIN & SHOCKLEY)

1954: Le transistor au silicium

1959 : Le transistor à effet de champs

1959 : Mise au point de la technologie "planar"1961 : Premier circuit intégré (6 composants)

1970: Technologie MOS

1976: Premier microprocesseur (2250 transistors sur 6 cm²)

1982: Naissance du premier PC IBM

1996: Intel Pentium (5,5 millions de transistors)

## Loi de Moore

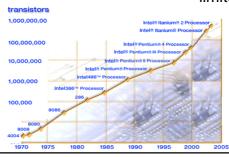
#### Gordon E. Moore

1965: "Cramming more components into integrated circuits"

- Le coût de production des circuits intégrés va rester stable dans le temps malgré l'augmentation de la complexité
- La densité d'intégration d'un circuit intégré double tous les 18 mois

1995 : Vérification OK

1997 : L'accroissement de la densité des microprocesseurs atteindra sa limite en 2017 (taille des atomes)





## Les défis des années 2000-2015

- Intel poursuit sa course à la finesse de gravure
  - Actuellement production avec un facteur d'échelle de 65 nm
  - Prévisions à 45nm pour 2007, 32nm pour 2009, 22 nm pour 2011 ...
- Les limites physiques seraient atteintes en 2018
  - A l'échelle de 5nm la charge électrique traversera le transistor même si il n'est pas sollicité
- Intel / ADM
  - 2001 Pentium 4: 42 millions de transistors
  - 2001 Athlon XP300+: 54 millions de transistors

Le milliard de transistors sur une puce a été atteint en 2008

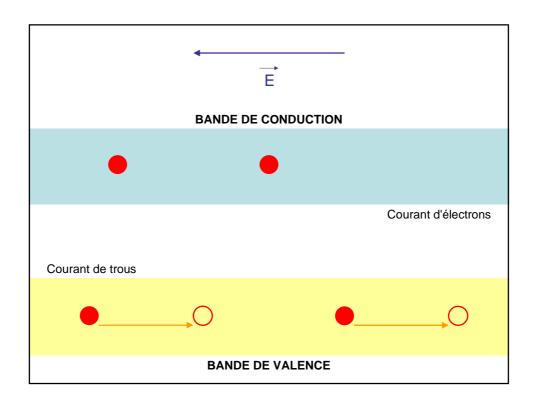
# **Conduction Electrique**

## Elle est assurée par

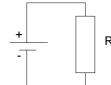
- les éléctrons périphériques des atomes appelés électrons "libres"
- les espaces libres laissés sur les dernières orbites des atomes appelés "trous"

## **Courant électrique:**

- déplacement des électrons du vers le + d'un générateur de tension
- "déplacement" des trous du + vers le d'un générateur



# Propriétés électriques des matériaux

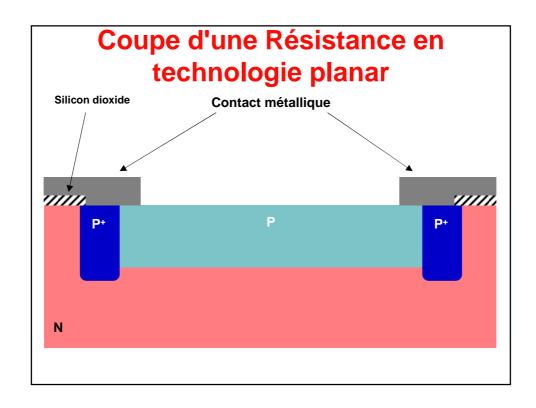


- Conducteur R petit, quelques  $\Omega$
- $^{R}$  Isolant R grand, plusieurs  $M\Omega$ 
  - Semi-conducteur R grand

Un semi-conducteur pur est un mauvais conducteur, mais en ajoutant quelques atomes différents de concentration  $N_A$  (accepteur) ou  $N_D$  (donneur) on peut modifier ses propriétés électriques et jouer sur sa résistivité

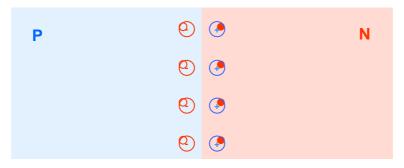
#### → DOPAGE

On obtient un semi-conducteur de type N (électrons porteurs de charge majoritaires ou de type P (trous porteurs de charge majoritaires)



# La jonction PN

ions - du côté P de la jonction ions + du côté N de la jonction



Une barrière de potentiel (0,6 à 0,7 V) se crée qui empêche le mouvement des charges à travers la jonction  $\rightarrow$  Diode

# Pourquoi le transistor?

#### Idée:

J'applique une tension d'excitation sur une triode et cette tension me permet:

- de faire passer un courant électrique entre deux noeuds de la triode
- de moduler le courant en fonction de la tension d'excitation

## Familles de transistors

## **BJT Bipolar Junction Transistor**

- 2 jonctions
- Effet transistor (phénomène complexe et difficile à expliquer)
- Applications essentiellement analogiques

#### **FET Field Effect Transistor**

- Fonctionnement simple : conduction électrique assurée par un canal
- 2 Familles : JFET (Canal diffusé), MOSFET (Canal induit)

Listes non exhaustives

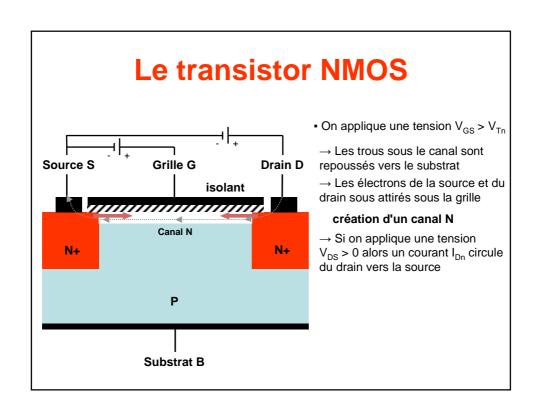
## Le transistor MOS

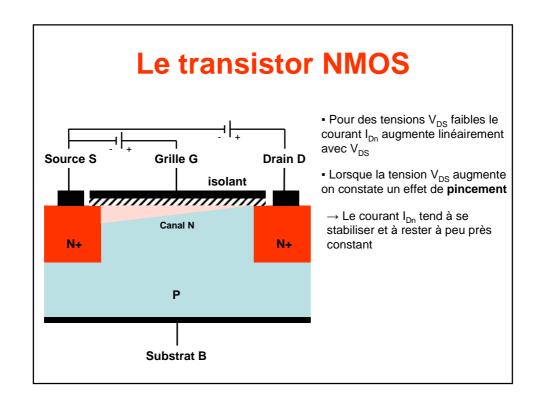
MOS: Metal Oxyde Semi-conductor

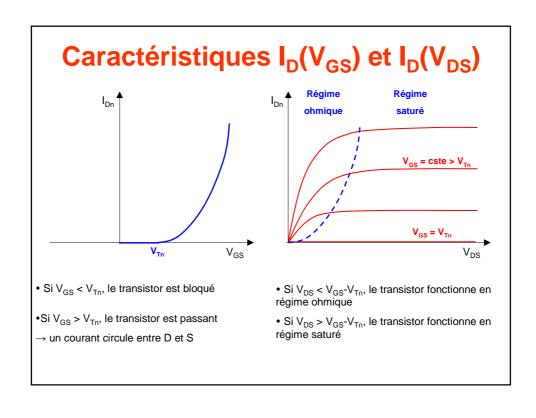
Canal N ou Canal P

## Principe de fonctionnement :

Une tension de commande supérieure à un seuil appliquée entre grille et source rend le transistor passant







## **Courant dans le NMOS**

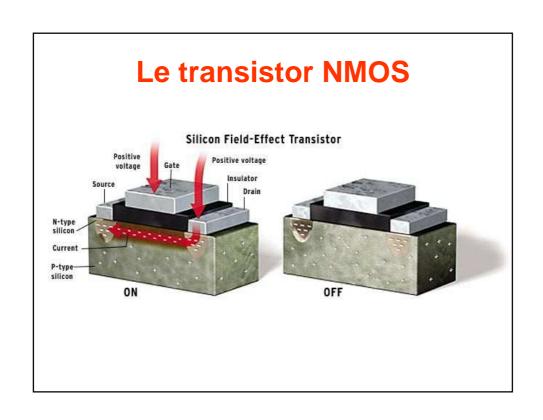
Tension de seuil :  $V_{Tn} \approx 1V$ 

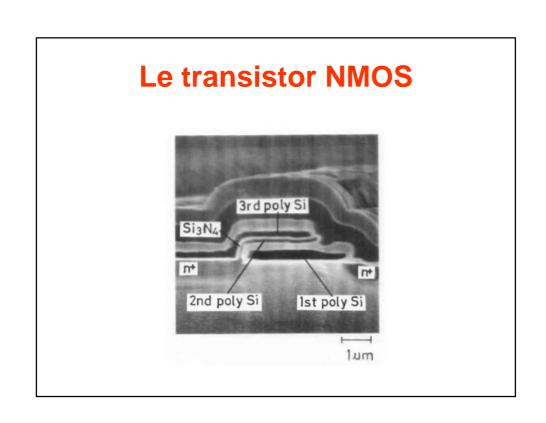
• Régime bloqué : Si  $V_{GS} \le V_{Tn}$ 

 $I_{Dn}=0$ 

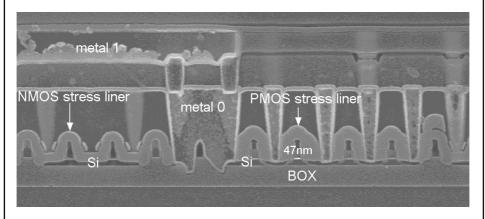
#### Remarques:

- On a choisi de négliger l'effet de modulation de largeur du canal
- · Si on néglige l'effet du substrat alors V<sub>Tn</sub> est constante
- Régime ohmique : Si  $V_{GS} \ge V_{Tn}$  et  $V_{DS} \le V_{GS}$   $V_{Tn}$  $I_{\text{Dn}} = \left(\frac{W_{\text{n}}}{L_{\text{n}}}\right) \mu_{\text{n}}.C_{\text{ox}} \ \left[ V_{\text{GS}} - V_{\text{Tn}} - \frac{V_{\text{DS}}}{2} \right] \ V_{\text{DS}}$
- Régime saturé : Si  $V_{GS} \ge V_{Tn}$  et  $V_{DS} \ge V_{GS}$   $V_{Tn}$  $I_{Dn} = \frac{1}{2} \left( \frac{W_n}{L_n} \right) \mu_n.C_{ox} \left[ V_{GS} - V_{Tn} \right]^2$

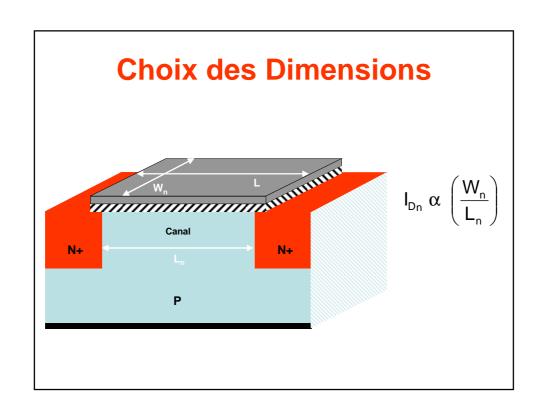


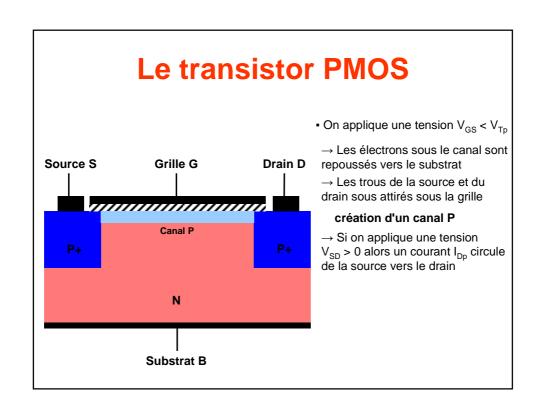


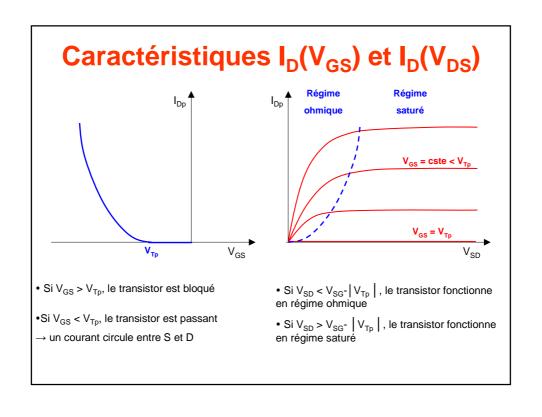
## Le transistor NMOS



Sony CXD2964GB Cell processor used in the Playstation III and the Microsoft X02046 PowerPC processor found in the Xbox 360 are both fabricated with essentially the same IBM 90 nm process





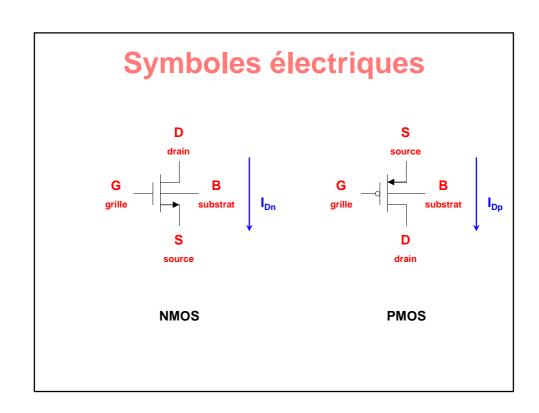


## **Courant dans le PMOS**

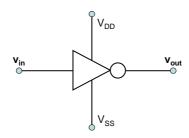
Tension de seuil :  $V_{Tp} \approx -1V$ 

#### Remarques:

- On a choisi de négliger l'effet de modulation de largeur du canal
- Si on néglige l'effet du substrat alors
   V<sub>Tp</sub> est constante
- Régime bloqué : Si  $V_{GS} \ge V_{Tp}$
- $I_{Dp} = 0$
- $$\begin{split} & \text{R\'e}\text{gime ohmique} : \text{Si V}_{\text{GS}} \leq \text{V}_{\text{Tp}} \text{ et V}_{\text{SD}} \leq \text{V}_{\text{SG}} + \text{V}_{\text{Tp}} \\ & I_{\text{Dp}} = \left(\frac{W_{\text{p}}}{L_{\text{p}}}\right) \mu_{\text{p}}.\text{C}_{\text{ox}} \ \left[\text{V}_{\text{SG}} + \text{V}_{\text{Tp}} \frac{\text{V}_{\text{SD}}}{2}\right] \text{V}_{\text{SD}} \end{split}$$
- Régime saturé : Si  $V_{GS} \le V_{Tp}$  et  $V_{SD} \ge V_{SG} + V_{Tp}$   $I_{Dp} = \frac{1}{2} \left( \frac{W_p}{L_p} \right) \mu_p.C_{ox} \left[ V_{SG} + V_{Tp} \right]^2$



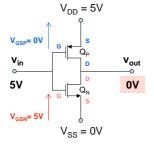
## L'inverseur CMOS

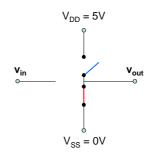


- $V_{DD}$  et  $V_{SS}$  sont les tensions d'alimentation de l'inverseur (par exemple 5V-0V) qui fixent le niveau logique HAUT ("1" logique) et le niveau logique BAS ("0" logique)
- Table de vérité :
  - si  $v_{in} = 0$ , alors  $v_{out} = 1$
  - si  $v_{in} = 1$ , alors  $v_{out} = 0$

## L'inverseur CMOS

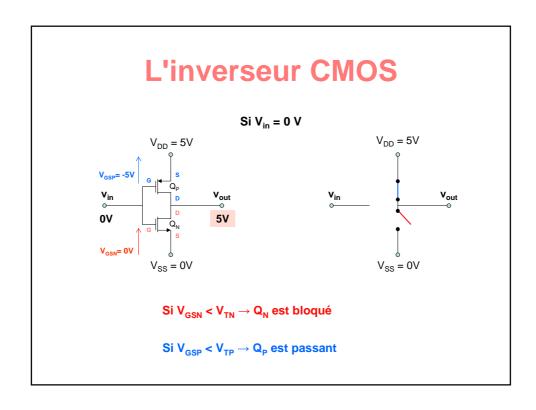


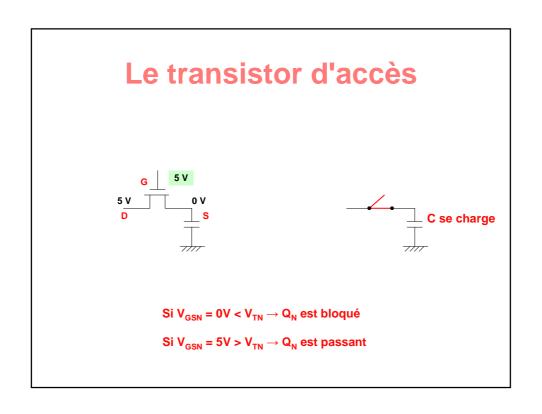


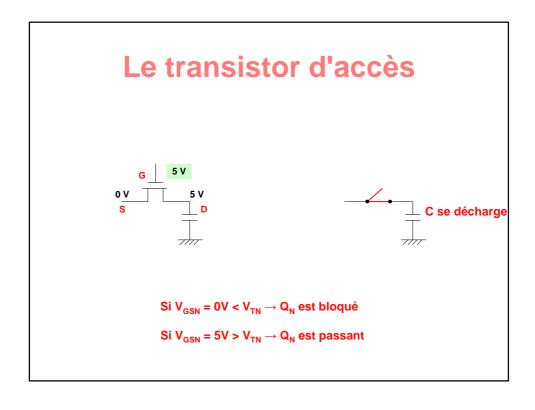


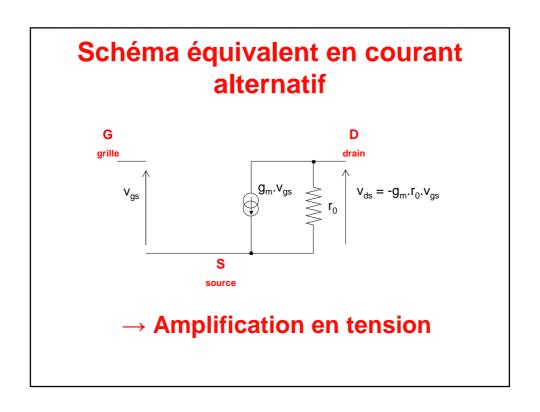
Si  $V_{GSN} > V_{TN} \rightarrow Q_N$  est passant

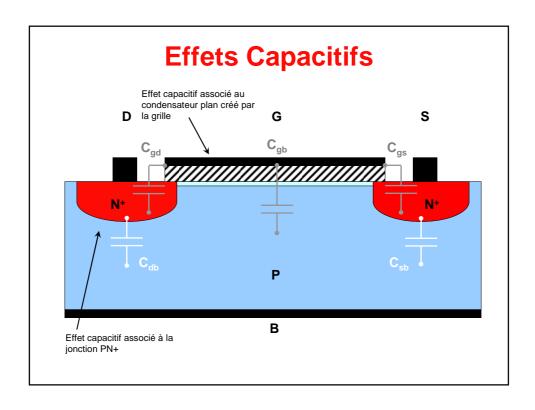
Si  $V_{GSP} > V_{TP} \rightarrow Q_P$  est bloqué











# Limitations dues aux Effets Capacitifs

L'ensemble des capacités peut être représentée par une capacité unique entre sortie et plan de masse.

## → Filtre RC passe-bas

Le fonctionnement en amplification est limité en hautes fréquences.

## → Constante de temps RC

Les temps de propagation (proportionnels à RC) sont limités.